

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公開番号】特開2004-277358(P2004-277358A)

【公開日】平成16年10月7日(2004.10.7)

【年通号数】公開・登録公報2004-039

【出願番号】特願2003-72164(P2003-72164)

【国際特許分類】

C 07 C	47/27	(2006.01)
C 07 C	37/16	(2006.01)
C 07 C	37/20	(2006.01)
C 07 C	39/15	(2006.01)
C 07 C	45/68	(2006.01)
C 07 C	47/57	(2006.01)
C 07 B	61/00	(2006.01)

【F I】

C 07 C	47/27	
C 07 C	37/16	
C 07 C	37/20	
C 07 C	39/15	
C 07 C	45/68	
C 07 C	47/57	
C 07 B	61/00	3 0 0

【手続補正書】

【提出日】平成17年11月11日(2005.11.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

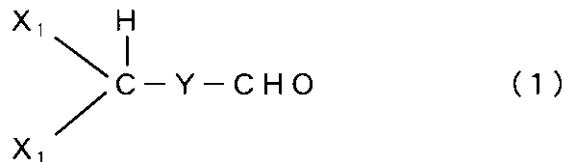
【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

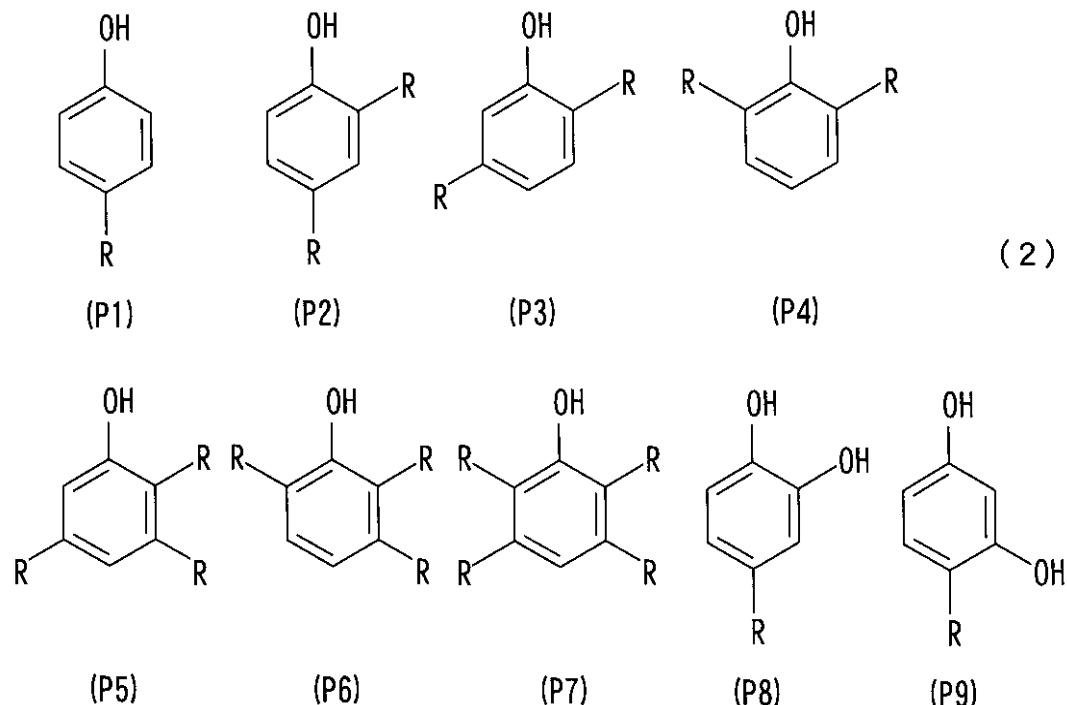
【請求項1】 下記一般式(1)：

【化1】



[式中、X₁は下記一般式(2)：

【化2】



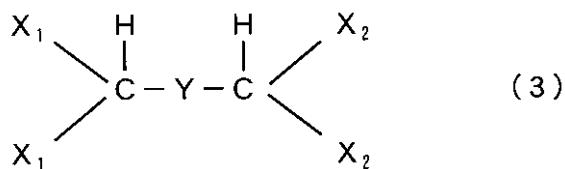
(RはそれぞれC₁～C₆の直鎖状若しくは分枝状またはC₃～C₆の環状アルキル基、フェニル基、ハロゲンを表す)で示されるフェノール類の反応残基を表し、Yはo-フェニレン、m-フェニレン、p-フェニレンまたは-(CH₂)_n-(n=0～4)を表す]で示されるビスフェノールモノアルデヒド化合物。

【請求項2】 請求項1に記載のビスフェノールモノアルデヒド化合物のための製造方法であって、酸性触媒の存在下、フタルアルデヒド類またはOHC-(CH₂)_n-CHO(n=0～4)で示されるジアルデヒド類と一般式(2)で示されるフェノール類とを、一般式(2)で示されるフェノール類及び前記ジアルデヒド類に対して富溶媒であり、一般式(1)で示されるビスフェノールモノアルデヒド化合物に対しては貧溶媒である有機溶媒中で反応させ、そのビスフェノールモノアルデヒド化合物の結晶を析出させることを特徴とする一般式(1)で示されるビスフェノールモノアルデヒド化合物の製造方法。

【請求項3】 フタルアルデヒド類またはOHC-(CH₂)_n-CHO(n=0～4)で示されるジアルデヒド類と一般式(2)で示されるフェノール類とのモル比が1.6～3.6である請求項2記載のビスフェノールモノアルデヒド化合物の製造方法。

【請求項4】 請求項1に記載のビスフェノールモノアルデヒド化合物とX₂のフェノール類の反応残基で表わされるフェノール類とを反応成分として得られる下記一般式(3)

【化3】



[式中、 X_2 はフェノール類の反応残基（ただし、該フェノール類の反応残基が $X_1 = X_2$ となる場合を除く）を表す]で示されるテトラキスフェノール化合物。

【請求項5】 請求項4に記載のテトラキスフェノール化合物のための製造方法であって、酸触媒の存在下、一般式(1)で示されるビスフェノールモノアルデヒド化合物とフェノール類（ただし、該フェノール類の反応残基が $X_1 = X_2$ となる場合は除く）とを反応させることを特徴とする一般式(3)で示されるテトラキスフェノール化合物の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、ビスフェノールモノアルデヒド化合物及びその製造方法、並びにこのビスフェノールモノアルデヒド化合物を用いたテトラキスフェノール化合物及びその製造方法に関する。更に詳しく言えば、ジアルデヒド類の片側のホルミル基のみに一般式(2)で示されるフェノール類を導入することで得られる一般式(1)で示されるビスフェノールモノアルデヒド化合物及びその製造方法、並びに一般式(1)で示されるビスフェノールモノアルデヒド化合物にフェノール類を導入することで得られる一般式(3)で示されるテトラキスフェノール化合物及びその製造方法に関するものである。